

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）では、新製品の研究開発、生産能力の拡大、品質の向上、事務の効率化等を図るべく、設備の拡充・改良並びに更新を進めており、当連結会計年度におきましては、厳しい経営環境を勘案して成長分野に集中し、3,069億円の設備投資を行いました。

その主要なものとしたしましては、ソフトウェア・サービス関係では、ブロードバンドIDC事業の強化を図るため、アウトソーシング設備及びネットワーク基盤設備を増強し、465億円を投資いたしました。

情報処理関係では、サーバ、ノートパソコン向け小型磁気ディスク装置の開発、製造設備を増強し、404億円を投資いたしました。

通信関係ではIMT-2000の国内、海外への本格展開に向け、IMT-2000対応基地局システムの開発、製造設備を増強し、194億円を投資いたしました。

電子デバイス関係では、最先端ロジックICの開発設備、ロジックIC、フラッシュメモリ、FRAM及びプラズマディスプレイパネルの製造設備を増強し、1,802億円を投資いたしました。なお、Fujitsu Microelectronics, Inc. グレシャム工場を平成14年1月に閉鎖いたしました。

上記セグメント以外では、電子事業及び電池事業の増産、合理化、省力化設備等を増強し、86億円を投資いたしました。

なお、設備投資額につきましては、当社の一般管理部門及び共通部門等の各セグメントに配布できない設備投資額115億円が含まれております。

2【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) ソフトウェア・サービス

平成14年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数 (人)	
		土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計		
提出会社	幕張システムラボラトリ (千葉県美浜区)	システム開発設備	3,708 (14)	13,863	68	1,563	19,203	1,398
	情報処理システムラボラトリ (東京都大田区)	システム開発設備	1,110 (24)	2,750	4,510	2,437	10,810	965
	館林システムセンタ (群馬県館林市)	アウトソーシング設備	1,913 (126)	9,128	983	9,093	21,118	269
	関西システムラボラトリ (大阪市中央区)	システム開発設備	9,263 (13)	3,848	22	370	13,505	703
在外子会社	ICL PLC (イギリス他) (注4.)	システム開発設備及び アウトソーシング設備	1,316 (200)	8,108	3,961	27,963	41,348	16,176

(2) 情報処理

平成14年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)		設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)
			土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計	
提出会社	長野工場 (長野県長野市)	磁気ディスク装置製造設備	920 (105)	10,222	10,604	6,102	27,850	2,213
	沼津工場 (静岡県沼津市)	コンピュータ製造設備	3,765 (550)	10,856	485	6,473	21,579	1,464
国内子会社	(株)PFU笠島工場 (石川県河北郡宇ノ気町)	情報処理システム製造設備	191 (138)	2,299	443	513	3,449	441
在外子会社	Amdahl Corporation (米国他) (注5.)	情報処理システム開発、製造設備	317 (33)	3,390	7,563	1,836	13,106	9,159
	Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippines カメルレイ工場 (フィリピン)	磁気ディスク装置製造設備	0 (284)	3,600	18,908	300	22,808	6,882

(3) 通信

平成14年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)		設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)
			土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計	
提出会社	小山工場 (栃木県小山市)	光伝送システム製造設備	981 (184)	7,635	4,056	7,130	19,805	2,379
	那須工場 (栃木県大田原市)	移動通信システム製造設備	1,250 (184)	3,896	1,391	6,829	13,367	948
在外子会社	Fujitsu Network Communications, Inc. リチャードソン工場 (米国テキサス州)	光伝送システム製造設備	4,132 (760)	10,928	1,874	14,254	31,188	2,265

(4) 電子デバイス

平成14年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)	
		土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計		
提出会社	三重工場 (三重県桑名郡多度町)	半導体製造設備	4,327 (307)	13,717	12,625	2,391	33,061	1,282
	岩手工場 (岩手県胆沢郡金ヶ崎町)	半導体製造設備	2,881 (290)	11,461	24,961	5,715	45,019	1,887
	会津若松工場 (福島県会津若松市)	半導体製造設備	3,432 (369)	7,458	8,571	2,396	21,858	1,542
	あきる野テクノロジーセンター (東京都あきる野市)	電子デバイスに関する研究開発設備	12,756 (121)	14,964	2,557	2,709	32,988	2,127
国内子会社	富士通エイ・エム・ディ・セミコンダクタ㈱ (福島県会津若松市)	フラッシュメモリ製造設備	0 (62)	24,995	73,203	2,112	100,312	1,551
	富士通カンタムデバイス㈱ 本社 (山梨県中巨摩郡昭和町)	化合物半導体製造設備	933 (107)	5,762	4,870	3,906	15,471	1,044
	新光電気工業㈱ 高丘工場 (長野県中野市)	半導体パッケージ製造設備	2,109 (97)	5,754	5,804	3,616	17,285	1,223

(5) 共通

平成14年3月31日現在

会社名及び事業所名 (所在地)	設備の内容	投下資本(百万円)					従業員数 (人)	
		土地 (面積千㎡)	建物 及び 構築物	機械装置	その他	合計		
提出会社	川崎工場 (川崎市中原区)	ソフトウェア、情報処理システム及び通信システムに関する研究開発設備	3,463 (175)	18,810	1,701	30,768	54,743	8,930
国内子会社	㈱富士通研究所 厚木研究所 (神奈川県厚木市)	ソフトウェア、情報処理システム、通信システム及び電子デバイスに関する研究開発設備	0 (19)	4,514	8,257	3,007	15,780	554

- (注) 1. 投下資本は期末帳簿価額によります。ただし、建設仮勘定を除きます。
2. 投下資本のその他とは車両及び運搬具並びに工具器具及び備品であります。
3. ICL PLC及びAmdahl Corporationの数値は、各社の連結決算数値であります。
4. 建物の一部を賃借しており、年間賃借料は7,615百万円であります。
5. ソフトウェア・サービス事業を一部含んでおります。また、建物の一部を賃借しており、年間賃借料は3,266百万円であります。
6. 富士通エイ・エム・ディ・セミコンダクタ㈱及び㈱富士通研究所の土地はすべて当社から賃借しているものであります。
7. Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippinesの土地はすべてFujitsu Development Corporation of the Philippinesから賃借しているものであります。

3【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ（当社及び連結子会社）の当連結会計年度後1年間の設備投資計画（新設・拡充）は、240,000百万円であり、事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称	平成14年3月末計画額 (百万円)	設備等の主な内容・目的
ソフトウェア・サービス	85,000	アウトソーシング設備関連設備、ネットワークサービス設備等の更新及び拡充
プラットフォーム	55,000	磁気ディスク装置、次世代移動通信システム関連の開発、研究開発設備の更新及び拡充
電子デバイス	90,000	フラッシュメモリ及びプラズマディスプレイパネルの製造設備、研究開発設備の更新及び拡充
金融	-	-
その他	5,000	オーディオナビゲーション機器の設計開発設備等の更新及び拡充
全社（共通）	5,000	-
計	240,000	-

（注）1．事業の種類別セグメントにつきましては、当連結会計年度後より、従来の情報処理、通信を統合し、プラットフォームとしております。

2．今後の所要資金240,000百万円は、自己資本により一部充当し、不足分については円貨建転換社債型新株予約権付社債発行（平成14年5月27日払込）等の外部資金により充当する予定であります。

3．設備投資の計画額は、消費税等抜きで表示しております。

4．経常的な設備の更新のための除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はありません。

5．全社（共通）は、当社の一般管理部門及び共通研究等のセグメント配賦不能な設備投資額であります。

6．各セグメントの計画概要は次のとおりであります。

ソフトウェア・サービス関係につきましてはアウトソーシング設備関連投資を中心に、当社単独で35,000百万円及び連結子会社で50,000百万円であります。

プラットフォーム関係につきましては、磁気ディスク装置関連投資を中心に、当社単独で35,000百万円及び連結子会社で20,000百万円あります。

電子デバイス関係につきましてはフラッシュメモリ製造設備関連投資18,000百万円等あります。